

第 159 回ラドテック研究会講演会

期 日：2018年10月30日（火）14：00～17：00

場 所：東京理科大学神楽坂キャンパス1号館17階／記念講堂

主 催：一般社団法人ラドテック研究会

協 賛：一般社団法人近畿化学協会・一般社団法人色材協会

一般社団法人日本接着学会・日本塗装技術協会・日本放射線化学会

一般社団法人有機エレクトロニクス材料研究会・フォトポリマー懇話会
合成樹脂工業協会（予定・順不同）

<講師と演題>

1) 14：00～14：40

「EB プロセスの基礎と応用」

早稲田大学 理工学術院

鷲尾 方一 氏

EB プロセスでは、当事者以外には知らされない、種々のノウハウや、技術的な難しさがついて回っている。そこで本講演では、まず EB プロセスを支える架橋技術や重合技術にかかわるノウハウについて簡単に説明し、その後、現在進められている種々の EB プロセス技術について概観する。

2) 14：40～15：20

「有機シランの自己組織化による光応答性ハイブリッドの創製」

早稲田大学 理工学術院

下嶋 敦 氏

有機シロキサン系材料は、ナノ構造制御によって多様な機能発現が期待できる。本講演では、アゾベンゼン修飾型アルコキシシランの自己組織化による各種メソ構造体の合成と光応答性について紹介する。

15：20 ～ 15：40 ♪♪♪♪♪ コーヒーブレイク ♪♪♪♪♪

3) 15：40～16：20

「アミンとラジカルを同時発生する光塩基発生剤の開発とそのアプリケーション」

日本化薬株式会社

寺田 究 氏

光照射によりアミンを発生する光塩基発生剤は硬化時の酸素阻害、硬化収縮、さらに金属腐食が無い利点があるため近年注目されている。今回の開発品ではこれまで課題であった吸収波長を拡大し、高効率かつラジカルも同時発生させることができる。本講演では様々な樹脂と混ぜた際の使い方から物性について説明する。

4) 16：20～17：00

「UVLED硬化プロセスの高効率化」

ヘレウス株式会社

河村 紀代子 氏

UVLEDが次世代産業用途のUV照射光源として注目されているが、UVLEDの発光波長特性から硬化材料の吸収とのマッチングを得ることが難しく、十分な硬化性を得られないことが課題となっている。講演では、硬化性を向上させるため、新規のUVLED硬化プロセスについて紹介する。

◆17：10～18：30 交流会・ミニ展示会 大会議室にて